

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成18年1月26日(2006.1.26)

【公開番号】特開2003-233191(P2003-233191A)

【公開日】平成15年8月22日(2003.8.22)

【出願番号】特願2002-376468(P2002-376468)

【国際特許分類】

G 03 F 7/039 (2006.01)

H 01 L 21/027 (2006.01)

【F I】

G 03 F 7/039 601

H 01 L 21/30 502R

【誤訳訂正書】

【提出日】平成17年11月30日(2005.11.30)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】特許請求の範囲

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

フォト活性成分及び樹脂を含み、該樹脂がアリールアルキル基を含むフォト酸レイビル単位を含む、フォトレジスト組成物。

【請求項2】

該フォト酸レイビル単位がフェニルアルキル基を含む請求項1に記載のフォトレジスト。

【請求項3】

該フォト酸レイビル単位が第三級ベンジル基を含む請求項1に記載のフォトレジスト。

【請求項4】

該フォト酸レイビル単位がエステル部位を含む請求項1乃至3のいずれか一つに記載のフォトレジスト。

【請求項5】

該フォト酸レイビル単位がアクリレート化合物の重合により提供される請求項1乃至4のいずれか一つに記載のフォトレジスト。

【請求項6】

該樹脂が更にヒドロキシフェニル単位及び/又は脂環式基を含む請求項1乃至5のいずれか一つに記載のフォトレジスト。

【請求項7】

該フォトレジストがアセタールフォト酸レイビル単位を含む樹脂を更に含む請求項1乃至6のいずれか一つに記載のフォトレジスト。

【請求項8】

(a) 請求項1乃至7のいずれか一つのフォトレジストのコーティング層を基体上に塗布し；及び(b)該フォトレジスト層を露光し、現像してレリーフイメージを得ることを含む、ポジ型フォトレジストレリーフイメージを形成する方法。

【請求項9】

その上に請求項1乃至7のいずれか一つのフォトレジスト組成物の層を被覆させたマイクロエレクトロニクスウェーハ基体を含む製品。

【請求項10】

アリールアルキル基を含むフォト酸レイビル単位を含む樹脂。